【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第２区分
【発行日】令和6年8月13日(2024.8.13)

【公開番号】特開2023-24108(P2023-24108A)
【公開日】令和5年2月16日(2023.2.16)
【年通号数】公開公報(特許)2023-031
【出願番号】特願2021-130197(P2021-130197)
【国際特許分類】
Ｇ０３Ｇ　5/14(2006.01)
Ｇ０３Ｇ　5/06(2006.01)
Ｇ０３Ｇ　5/047(2006.01)
【ＦＩ】
Ｇ０３Ｇ　5/14　１０１
Ｇ０３Ｇ　5/14　１０１Ｄ
Ｇ０３Ｇ　5/14　１０１Ｅ
Ｇ０３Ｇ　5/06　３７１
Ｇ０３Ｇ　5/047

【手続補正書】
【提出日】令和6年8月2日(2024.8.2)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００８９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００８９】
[電荷発生層用塗布液８の調製例]
電荷発生層用塗布液５の調製例において、サンドミルで３０時間のミリング処理を１０時間に変更したこと以外は、電荷発生層用塗布液５と同様にして、電荷発生層用塗布液８を調製した。
遠心分離処理前までに得られた顔料はＣｕＫα線を用いたＸ線回折スペクトルにおいて、ブラッグ角度２θの７．５°±０．２°、９．９°±０．２°、１６．２°±０．２°、１８．６°±０．２°、２５．２°±０．２°及び２８．３°±０．２°にピークを有する。
また、表１に示すように、得られた顔料は小角Ｘ線散乱を用いて測定した結晶子のサイズ分布において５５ｎｍの位置にピークが存在し、ピークの半値幅は４８ｎｍであった。